

Rec'd PCT/PCT 19 JAN 2005

PCT/JP03/00287

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

28.03.03

10/501504

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 1月16日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-008022

[ ST.10/C ]:

[ JP2002-008022 ]

出 願 人

Applicant(s):

学校法人日本大学

REC'D 05 MAY 2003

WIPO

PCT

BEST AVAILABLE COPY

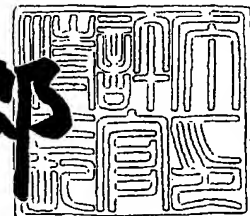
PRIORITY  
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 3月11日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3015676

【書類名】 特許願

【整理番号】 52015

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 A61K 7/48

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都千代田区九段南四丁目8番24号 学校法人日本  
                                大学内

    【氏名】 秋久 俊博

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都千代田区九段南四丁目8番24号 学校法人日本  
                                大学内

    【氏名】 石川 稔矩

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都千代田区九段南四丁目8番24号 学校法人日本  
                                大学内

    【氏名】 鈴木 良弘

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都千代田区九段南四丁目8番24号 学校法人日本  
                                大学内

    【氏名】 望月 征四郎

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都千代田区九段南四丁目8番24号 学校法人日本  
                                大学内

    【氏名】 岸田 宏隆

【特許出願人】

    【識別番号】 899000057

    【氏名又は名称】 学校法人日本大学

【代理人】

    【識別番号】 100074505

【弁理士】

【氏名又は名称】 池浦 敏明

【代理人】

【識別番号】 100106530

【弁理士】

【氏名又は名称】 古宮 一石

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009036

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ベニカミキリフラスを有効成分とする皮膚外用薬

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする抗アレルギー剤。

【請求項 2】 ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする皮膚外用薬。

【請求項 3】 ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする皮膚炎抑制剤。

【請求項 4】 ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする浴用剤。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ベニカミキリフラスを有効成分とする皮膚外用薬に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

人が生命体を維持して、活動を行っていく上で、体表面の皮膚に感ずる痒みとは、皮膚や粘膜の痛点が弱い刺激によって生じる感覚、掻痒感のことである。

近年、生活環境の変化に伴いアトピー性皮膚炎の発症が激増している。アトピー性皮膚炎の発症には環境要因が大きく作用するといわれている。環境要因には、非アレルギー的要因とアレルギー的要因に分けられる。非アレルギー的要因には、皮膚の乾燥、発汗、皮膚の加圧・加重、皮膚の掻破等によるものである。アレルギー的要因では、食物アレルギーの吸引によるもの、だに、ハウスペット、花粉、金属等との接触などによるものである。

非アレルギー要因による場合には、要因と接触することで、痒みが生じ、粗の痒みに対して皮膚を掻くことにより皮膚組織が破壊され、皮膚が有する防御機能が損なわれ、皮膚過敏や病原菌による感染症状が引き起こされる。

アレルギー症状は、体内で起こる抗原抗体反応による免疫グロブリンE（IgE）の産生により、結果的に肥満細胞の細胞膜を刺激し、ヒスタミン、ロイコトリエン、セロトニンなどの活性物質を放出することにより起こる。放出されたこれらの物質は、血管透過性を促進させる作用や、平滑筋を収縮させる作用があるため、白血球や蛋白質を血管から漏出させたり、炎症により気管支を収縮させ、喘息を引き起こす原因となる。また、体内にアレルゲンが侵入するとT細胞が感作され、再度アレルゲンに接触するとリンホカインと呼ばれる炎症性因子を放出し、反応を起こす。このような症状に対して、予防・改善に有効な因子を探し出す研究が行われている。

そして、抗アレルギー成分に関し、ボルネオールの肥満細胞膜安定可能を利用するもの（特開平6-211713号公報）、放線菌培養液による炎症抑制作用を利用するもの（特開平5-25053号公報）などが知られている。また、ごま油を摂取することによって、アレルギー反応の原因となるロイコトリエンの産生を抑制する効果が知られている（Prostaglandin、第36巻、第3号、1988年）。また、ドコサヘキサエン酸（DHA）、或いはリノレン酸を含む油脂の抗アレルギー性を利用するもの（特開平2-29081号公報）が知られている。これらの天然に存在する抗アレルギー剤は副作用が少ないが、抗アレルギー症状の予防及び治療には、その効果は、十分ではない。

ヒスタミンを代表とする多数の活性物質が肥満細胞や好塩基球から遊離されることが影響を与えていることから、前記の抗アレルギー症状を軽減させるために、ヒスタミン受容体阻害剤が有効と考えられ、クロラルフェニルアミン、ジフェンヒドラミンなどの抗ヒスタミン剤や副腎皮質ホルモンが用いられるが、これらの薬剤を用いる場合には、副作用を伴うことが問題とされている。

このようなことから、副作用が少ない薬剤の開発が進められており、天然物由来の物質の開発が進められている。

この種の天然物としてはキク科ヒマワリ属の花弁抽出物を用いるもの（特開2000-351723号）、アカナノキなどの抽出物（特開2000-26307号）、テイトリの抽出物（特開平11-255661号）、トコフェロール抽出物（特開2001-163764号）、キトサンを用いるもの（特開20

01-55335号)などが開発されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、皮膚に感ずる種々の痒み防止及び改善に対して有効な、天然物由来のかゆみどめ、アトピー性皮膚炎やアレルギー性症状の予防、改善及び治療となる、抗アレルギー剤、皮膚外用剤、皮膚炎抑制剤及び浴用剤を提供することである。

【0004】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意研究し、竹類に寄生するベニカミキリの幼虫の排泄物であるベニカミキリフラスの成分を含む組成物、ベニカミキリフラスを水或いは有機溶媒で処理して得られる抽出物を用いて、ヒスタミン遊離抑制試験及びロイコトリエン分泌抑制試験を行ったところ、高活性を示し、アレルギー性の皮膚炎、アトピー性皮膚炎などのアレルギー性症状に有効に作用することを見出し、さらに、実際にヒスタミンが関与するアレルギー性の皮膚炎、アトピー性皮膚炎やアレルギー性症状、虫さされ、環境要因による皮膚そう痒症等に用いて試したところ、広範囲にわたる痒み症状に対して短時間で顕著な効果が見られ、各種の痒みの内服薬及び外用薬として予防及び改善に有効であること、更に機能性食品として用いると、痒みの予防・改善に有効であること、更にこれらを浴用剤として用いると、痒みの予防・改善にも有効にあることを見出して、本発明を完成させた。

【0005】

すなわち、本発明によれば、以下の発明が提供される。

- (1) ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする抗アレルギー剤。
- (2) ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする皮膚外用薬。
- (3) ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする皮膚炎抑制剤。

(4) ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする浴用剤。

【0006】

【発明の実施の形態】

本発明の対象であるベニカミキリフラス成分を取得するために用いられる原料の竹としては、ホウソウチク属、シホウチク属、マダケ属、シュドササ属、ササモルフア属、ナリヒラタケ属、トウチク属などの竹類が用いられる。なかでも、マダケ属の孟宗竹及びハチクが好適に用いられる。これらの竹が切り取られ、放置されると、ベニカミキリ (*Purpuricenus temminckii* Guerin-Meneville 1844) が卵をうみつけ、その幼虫が竹類を食べて成長する。その成長過程で、排泄物を竹の中に残す。これをベニカミキリフラスと呼ぶ。このベニカミキリフラスを集めて、本発明の抗アレルギー剤などの対象物質とする。

なお、ベニカミキリは、主に我が国では、本州（ヤブツバキ帯ーブナ帯下部）、佐渡、四国、九州、奄岐、対馬などに分布し、春から夏にかけて出現する。

【0007】

竹から得られるベニカミキリフラスは、しっとりとした粒状の薄黄色を帯びた組成物として得られる。

このベニカミキリフラスは、水分を含有するので、これを乾燥させることにより水分を取り除いて粉状体とすることができる。乾燥させるには、30～80℃の条件下に行う。80℃を越える高温で処理すると、分解などを伴うので、好ましくない。

この粉状のものを、ガーゼなどを用いて患部に直接接触させることにより、薬剤として使用することができる。また、このベニカミキリフラスは、格別水分などを取り除くことなく、そのまま薬剤として使用することもできる。後述する実施例で直接用いた結果を示すが、薬剤として良好な結果を示すものである。

【0008】

ベニカミキリフラスより水抽出物を取り出す場合には、過剰量の水（熱水）と容器内で接触させる。水には熱湯を用いることが効果的である。通常、0.001～0.007重量%程度の濃度になるように水量を調節する。抽出には、環流条件下に加熱する。加熱時間は、適宜設定する。加熱処理は、通常少なくとも1

5分以上、1時間程度は必要である。

その結果、ベニカミキリフラスの抽出成分は熱水層に移行させることができる。この熱水処理は2回以上、通常3回程度まで繰り返すことが有効である。

この一回目の操作により、一般には、ベニカミキリフラス重量に対して0.3～1.0%程度、通常0.7重量%程度の割合で液状物が得られる。このようにして得られる液状物を環流条件下に濃縮する。最終的に、ベニカミキリフラスの抽出物は、茶褐色の粉末状のものとして得られる。収量は、ベニカミキリフラスの重量に対して1.0～2.0重量%程度のものが得られる。

温水の利用も可能である。圧力をかけた条件下にも行うことができる。このようにして得られる粉末状の水抽出物を、使用に際しては、適宜水に溶かして薬剤として利用する。

後の実施例に示すように竹フラス10gを用いて水抽出を行った結果、176.2mgのフラス抽出物を得ている。

#### 【0009】

ベニカミキリフラスを有機溶媒に接触させて処理することにより有機溶媒による抽出物としたものを薬剤として利用することができる。

有機溶媒としては、エタノール、メタノール、イソプロパノールなどのアルコール類、グリセリン、エチレングリコール、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコールなどの多価アルコール又はその誘導体、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、酢酸エチル、酢酸イソプロピルなどのエステル類、エチルエーテル、イソプロピルエーテルなどのエーテル類を挙げることができる。また、石油エーテル、n-ヘキサン、n-ペンタンなどの脂肪族炭化水素なども用いることができる。

これらの中では、エタノール、1,3-ブチレングリコール、プロピレングリコールなどが用いられる。これらには、水を含めて混合溶媒として用いることもできる。

いずれも溶媒抽出した後、更に他の溶剤に接触させて、さらに特定の成分を取り出すことができるが、そのような操作を施すことなく、エタノール或いは1,3-ブチレングリコール溶媒のものを適当な濃度のものとして、患部に直接、塗



りつける、或いはガーゼなどにしみこませた状態であてがうことによって、用いることができる。

#### 【0010】

ベニカミキリフラス成分の有機溶媒抽出に当たっては、ヘキサンなどで抽出を行って、ヘキサン抽出物と残さに分け、この残さをメタノール抽出し、メタノール抽出物と残さに分け、メタノール抽出物を酢酸エチル溶解成分とブタノール溶解成分に分けることができ、残さを水抽出を行うなどして、各種溶解成分を取り出すこともできる。

#### 【0011】

ベニカミキリフラスの成分を含有する組成物は、抗アレルギー剤として用いることができる。抗アレルギー剤としては、経口内服薬、静脈注射、外用薬として利用できる。又、機能性食品や菓子などの食品及び各種飲料中に添加して痒み防止或いは改善をはかることもできる。又、皮膚外用剤、皮膚保護剤、皮膚炎抑制剤、ローション及びクリーム及び石鹸などに添加して、痒み防止・改善をはかる化粧品として利用することもできるし、痒み防止・改善作用も有する頭髮剤にも用いることもできる。また、浴用剤に添加して浴用剤に痒み防止・改善をはかるようにすることもできる。場合によっては、下着や靴下などの衣料に含有させて、衣料に痒み防止・改善の作用をもたせることもできる。

#### 【0012】

ベニカミキリフラスを、水抽出物、有機溶剤抽出物、或いは乾燥物として0.001～20重量%程度の濃度のものとして用いることが一般的である。

この中に、抗炎症剤、抗アレルギー性疾患剤である、アズレン、塩酸ジフェンヒドラミン、dl- $\alpha$ トコフェロール及びその誘導体と共に用いることもできる。

また、多糖類などの天然高分子、でんぷん、水溶性高分子、アニオン、カチオン、ノニオンなどの界面活性剤を用いることもできる。

#### 【0013】

入浴剤として用いる場合には、粉状のベニカミキリフラス、炭酸水素ナトリウム、無水硫酸ナトリウム、硼砂、香料、安定剤などともに混合したものを、水な

どに溶解抽出物を適宜水に溶かして薬剤として利用する。また、液状のベニカミキリフラスをホホバ油、香油、色素、保湿剤、界面活性剤と混合した液状のもとでも利用することができる。

【 0 0 1 4 】

本発明のベニカミキリフラスは、ヒスタミン遊離抑制及びロイコトリエン分泌抑制の試験を行うことによって、その効果を確認することができる。

また、実際に使用した結果により効果を確認することができる。

【 0 0 1 5 】

【実施例】

以下、実施例により本発明の内容を説明する。

実施例 1

ベニカミキリフラスの有機溶媒による抽出液の製造

竹から得られたベニカミキリフラス 5 9 1 g を、ヘキサンで抽出を行って、ヘキサン抽出物 3 3 2 m g と残さに分け、この残さを、メタノール抽出し、メタノール抽出物 1 4 . 6 g と残さに分け、メタノール抽出物を酢酸エチル溶解成分 3 . 6 8 5 g 及びブタノール溶解成分 1 . 9 3 1 g に分けることができ、メタノール抽出残さを水（熱水）抽出を行って、水抽出物 1 2 . 1 3 2 g を得た。

【 0 0 1 6 】

実施例 2

ベニカミキリフラスの水抽出液の製造

竹から採取したベニカミキリフラス 1 0 g を、水 5 0 0 リットルに溶解させ、加熱し、環流条件下に加熱した。加熱処理は、5 時間行った。

得られたベニカミキリフラスの抽出成分を含有する成分に関し、同様に 2 回操作を繰り返した。その結果、ベニカミキリフラス水抽出物 1 7 6 . 2 m g を得た。以後の実施例ではこれを必要量の水に溶解して用いる。

【 0 0 1 7 】

実施例 3（ヒスタミン遊離抑制試験）

実施例 2 で得られたベニカミキリフラス水抽出液のヒスタミン遊離抑制効果を、ラット由来好塩基球細胞（R B L - 2 H 3）から遊離されるヒスタミンを指標

とする抗アレルギー作用試験法を用いて評価した。

RBL-2H3を24穴プレートに $2.5 \times 10^5$ 細胞/穴となるように細胞を播種し、24時間培養（二酸化炭素5%、37度）後、Phosphate buffer saline (PBS) で1回洗浄した後、各濃度の竹チップ抽出液/20mM HEPES-DMEM 180 $\mu$ Lを加えて二酸化炭素5%、37度で30分培養し、次に、刺激剤A23187（カルシウムイオノファ），を20 $\mu$ L加えて30分培養した後、上清200 $\mu$ Lを取り出した。また、20mM HEPES-DMEM (Medium) 及び界面活性剤0.05% Triton X-100（細胞壁を溶解することで細胞中の全ヒスタミン含量を測定する）を用いて上述と同様に刺激して得られた上清を各々NegativeControl、PositiveControlとした。

このようにして取り出した上清中のヒスタミン含量はHistamine enzyme-linked immunoadsorbent assay (ELISA) Kit (ICN Pharmaceuticals社製)を用いて定量した。なお、ヒスタミン遊離率およびコントロールに対するヒスタミン遊離率は式1及び式2を用いて算出した。コントロールに対する各濃度のヒスタミン遊離率を図1に示す。

ヒスタミン遊離率 (%)

$$= ((A - B) / (C - B)) \times 100 \quad \dots (式1)$$

Aはベニカミキリフラス水抽出液処理した細胞にA23187で刺激した上清中のヒスタミン含量

BはNegativeControlによる上清中のヒスタミン含量

CはPositiveControlによる上清中のヒスタミン含量

コントロールに対するヒスタミン遊離率 (%)

$$= (D / E) \times 100 \quad \dots (式2)$$

Dは各濃度のベニカミキリフラス水抽出液のヒスタミン遊離率 (%)

EはA23817刺激のみ（ベニカミキリフラス水抽出液で未処理）のヒスタミン遊離率 (%)

コントロールはA23187で刺激のみ（ベニカミキリフラス水抽出液で未処理）の上清中のヒスタミン遊離率 (%)

結果

A23187はブランクの結果である。

0.625 mg/mlの場合には、顕著に減少しており、その後、1.25 mg/ml、1.25 mg/ml以降徐々に値が減少している。ヒスタミン遊離抑制効果は十分にあることが理解できる。

【0018】

#### 実施例4

(ロイコトリエン分泌抑制試験)

ベニカミキリフラス水抽出液のロイコトリエン分泌抑制効果をラット由来好塩基球細胞(RBL-2H3)から分泌されるロイコトリエンを指標とする抗アレルギー作用試験法を用いて評価した。

RBL-2H3を24穴プレートに $2.5 \times 10^5$ 細胞/穴となるように細胞を播種し、24時間培養(二酸化炭素5%, 37度)後、Phosphate buffer saline (PBS)で1回洗浄した後、各濃度のベニカミキリフラス水抽出液/20 mM HEPES-DMEM 180  $\mu$ Lを加えて二酸化炭素5%, 37度で30分培養し、次に、抗原20  $\mu$ L加えて刺激し30分培養した後、上清200  $\mu$ Lを取り出した。

このようにして取り出した上清中のロイコトリエン分泌量はLeukotriene C<sub>4</sub> Enzyme immunoassay(EIA) Kit(Cayman Chemical, Ann Arbor, MI)を用いて定量した。なお、ロイコトリエンの分泌量はロイコトリエン標準溶液(0~1000 pg/ml)による検量線を用いて算出した。各濃度によるロイコトリエン分泌抑制効果を図2に示す。

#### 結果

DNP-BSAは、ブランクの結果である。0.625 mg/ml以降、徐々に減少し、5.0 mgでは、45 pg/mlという小さな結果の値を得た。このことから、ベニカミキリフラス水抽出物のロイコトリエン分泌抑制効果は、十分に確認することができた。

【0019】

#### 実施例5

ベニカミキリフラスの水抽出物を精製水に溶解し、0.005%濃度として、

かゆみを呈する際に随時患部に塗布させ、かゆみ症状の改善状況について表1に示す結果を得た。なお、本剤使用期間中は抗ヒスタミン剤など別の抗アレルギー剤の使用は中止させた。

本発明による皮膚外用剤を塗布した症例1～11皮膚掻痒症、アトピー性皮膚炎、水虫、あせも、蕁麻疹、虫刺され、血液人工透析、かぶれ、刺青、しもやけ、とびひ) 結果は、これら全ての症状によるかゆみに本剤が極めて有効であることを示しており、止痒効果の無い例及び塗布により症状(かゆみ及び皮膚炎など)の悪化した例は一件も認められなかった。

その結果を整理して表に整理したものが、表1である。

【0020】

【表1】

皮膚外用剤塗布による止痒効果

症例	かゆみ症例	対象症例数	顕著	やや有効	無効	悪化
1	皮膚掻痒症	12	8	4	0	0
2	アトピー性皮膚炎	8	7	1	0	0
3	水虫	5	5	0	0	0
4	あせも	3	3	0	0	0
5	蕁麻疹	2	1	1	0	0
6	虫刺され	2	2	0	0	0
7	血液人工透析	1	1	0	0	0
8	かぶれ	1	1	0	0	0
9	刺青	1	1	0	0	0
10	しもやけ	1	1	0	0	0
11	とびひ	1	1	0	0	0

【0021】

## 結果

以上の表の記載から明らかなように、顕著に効いたものが多く、そして、有効が若干有り、全体として顕著に効いたといえることができる。無効及び悪化というものは皆無であった。そして、各種の原因による痒みに有効であることが理解できる。

本調査結果について、集計方法の整理して見ると以下のことがわかる。

男女の割合は、各々50%であり、同じである。年齢及び性別による患者の分布

の状態は、図 3 に示すとおりである。ベニカミキリフラスの使用に関しては、水抽出物（90%）、粉末（3%）及びその両方を併用したもの（7%）であった。

効果が現れる迄の時間は、殆ど 1 分から 5 分の間にあり、痒みに対して即効性があることがわかる（図 4）。痒い症状の原因の分布は、図 5 に示すとおりである。この結果から、広範囲の症状に有効であることが理解できる。

#### 【 0 0 2 2 】

以下に、処方例の一例を示す。本発明はこれに限定されるものではないことは言うまでもない。

##### ローション状痒み防止・軽減剤

エタノール	1 5 . 0 0 （重量%）
ヒドロキシエチルセルロース	0 . 1 0
パラオキシ安息香酸メチル	0 . 1 0
ベニカミキリフラス水抽出物	0 . 2 0
精製水	8 4 . 6 0

#### 【 0 0 2 3 】

##### 乳状痒み防止・軽減剤

ステアリン酸	0 . 2 （重量%）
セタノール	1 . 5
ワセリン	3 . 0
流動パラフィン	7 . 0
ポリオキシエチレン（10 E. O）	
モノオレイン酸エステル	1 . 5
酢酸トコフェロール	0 . 2
グリセリン	5 . 0
パラオキシ安息香酸メチル	0 . 1
トリエタノールアミン	0 . 1
ベニカイミキリ水抽出物	0 . 4
精製水	8 1 . 0

【0024】

ゲル状痒み防止・軽減剤

ジプロピレングリコール	10.0 (重量%)
カルボキシビニルポリマー	0.5
水酸化カリウム	0.1
パラオキシ安息香酸メチル	0.1
ベニカミキリ水抽出物	0.5
精製水	88.8

【0025】

クリーム状痒み・軽減防止剤

みつろう	6.0 (重量%)
セタノール	5.0
還元ラノリン	8.0
スクワレン	27.5
グリセル脂肪酸エステル	4.00
親油性グリセルモノステアリン酸エステル	2.0
ポリオキシエチレン(20E.O)ソルビタン	
モノラウリル酸エステル	5.0
プロピレングリコール	5.0
パラオキシ安息香メチル	0.1
ベニカミキリフラス水抽出物	0.5
精製水	36.9

【0026】

散剤状痒み軽減防止剤

ケイ酸アルミン酸マグネシウム	95.3 (重量%)
カルボキシメチルセルロースカルシウム	4.5
ベニカミキリフラス乾燥粉末	0.2

【0027】

浴用剤

炭酸水素ナトリウム	63.0 (重量%)
無水硫酸ナトリウム	30.0
硼砂	2.0
ベニカミキュラフラス乾燥粉末	5.0

【0028】

浴用剤

精製ホホバ油	5.0 (重量%)
ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート	20.0
グリセリンモノラウレート	5.0
流動パラフィン	2.0
ラウリン酸ジエタノールアミド	2.0
ベニカリキリフラス水抽出物	3.0
精製水	67.0

【0029】

【発明の効果】

本発明によるベニカミキリフラスを成分として含有する皮膚外用剤、皮膚炎抑制剤、及び入浴剤は、皮膚に感ずる各種の痒み、アレルギー性の皮膚炎、アトピー性皮膚炎やアレルギー性症状、虫さされ、皮膚そう痒症の予防及び治療薬として有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

ベニカミキリフラス水抽出物のヒスタミン遊離抑制試験の結果を示す図である。

【図2】

ベニカミキリフラス水抽出物のロイコトリエン分泌抑制試験の結果を示す図である。

【図3】

年齢及び性別による患者の分布の状態を示す図である。

【図4】



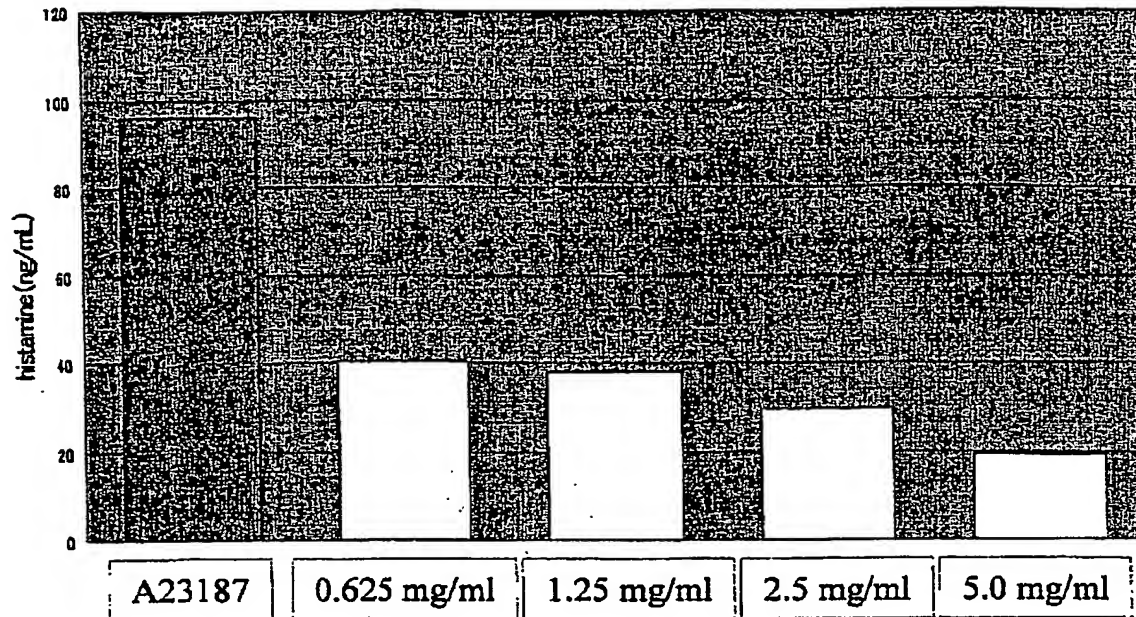
痒みに対する改善の効果が現れるまでの時間を示す図である。

【図 5】

痒みの原因となる症状の分布を示す図である。

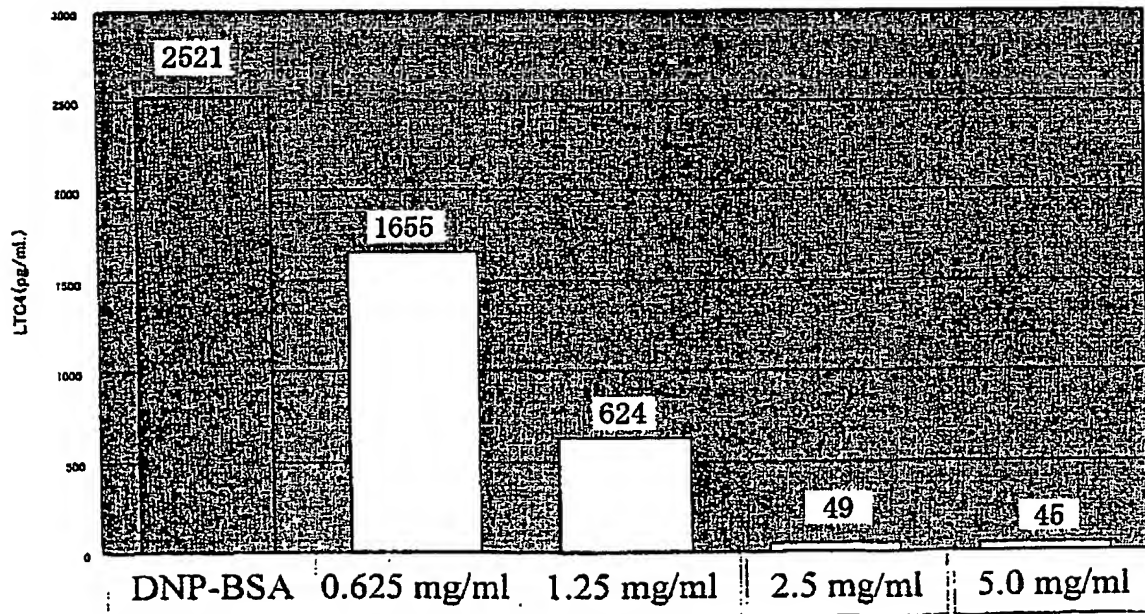
【書類名】 図面

【図 1】



ベニカミキリフラス水抽出物のヒスタミン遊離抑制効果

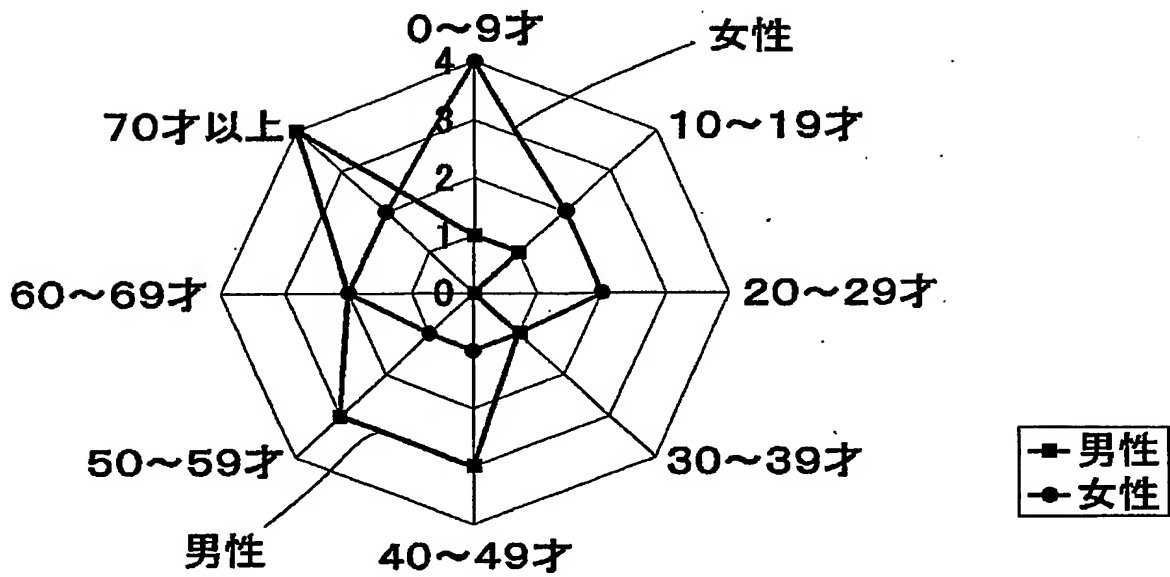
【図 2】



ベニカミキリフラス水抽出物のロイコトリエン分泌抑制効果

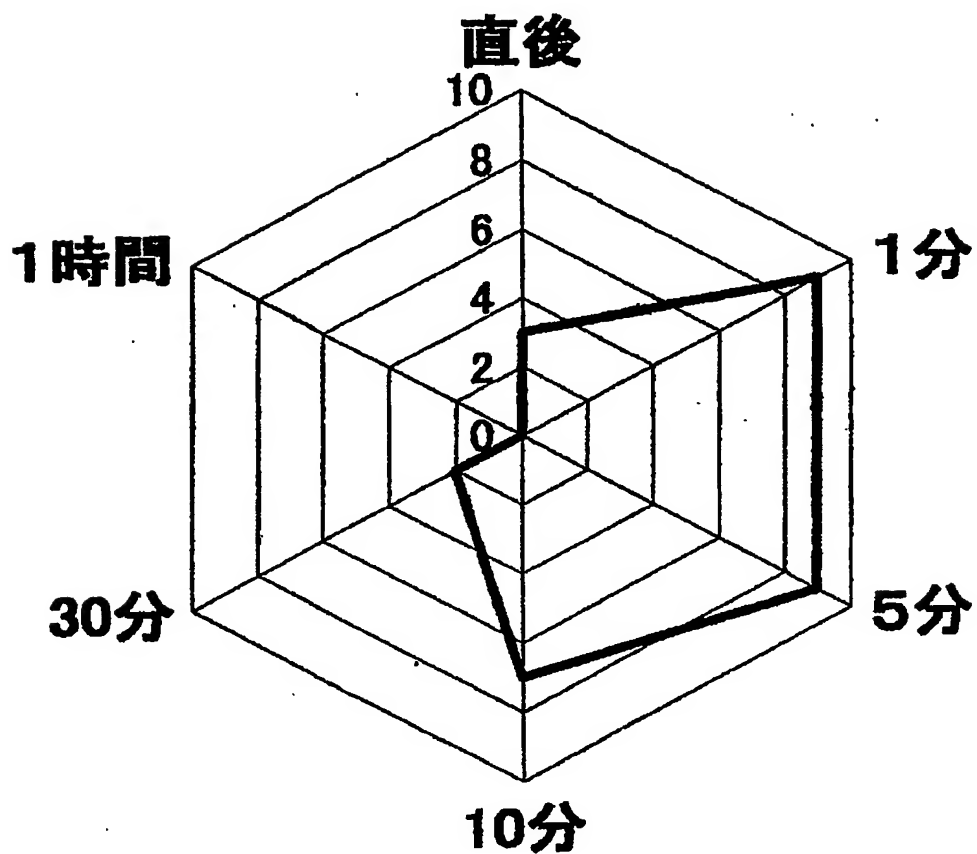
【図3】

### 年齢・性別



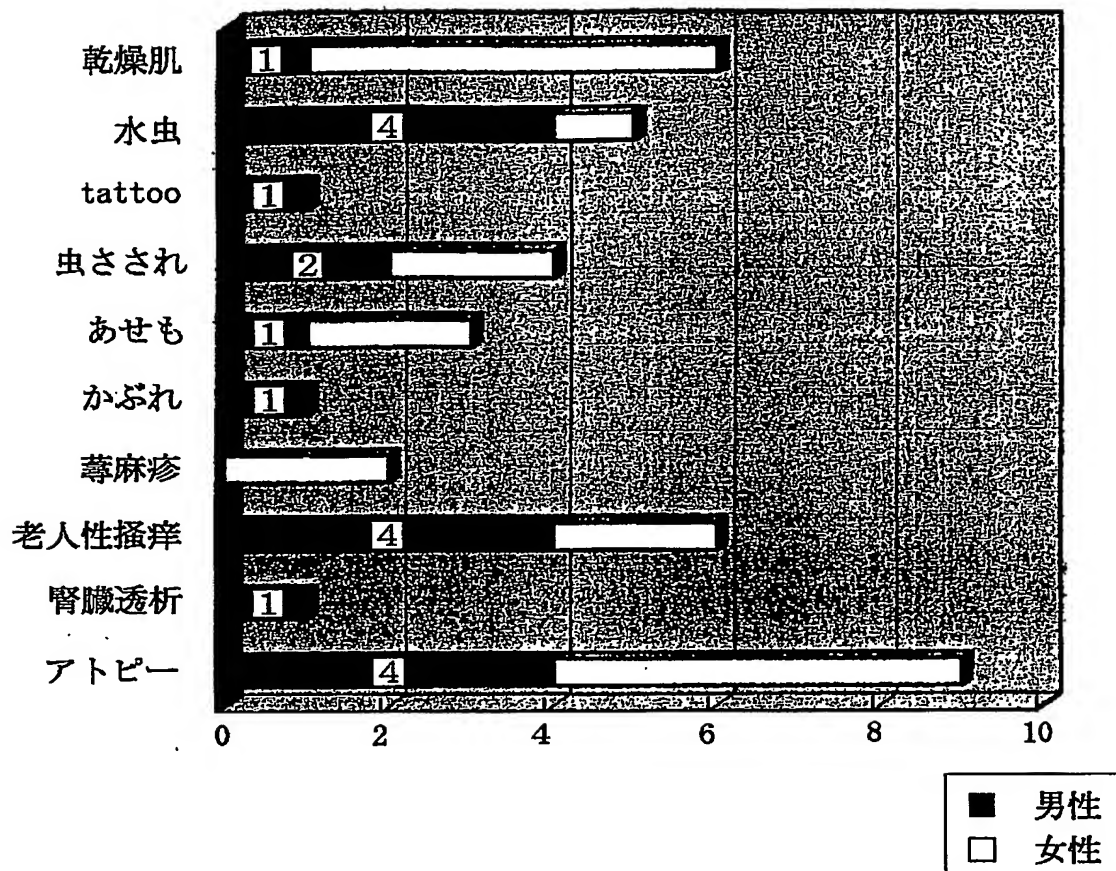
【図4】

## 効果が現れるまでの時間



【図5】

症状（男女別）



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 皮膚に感ずる種々の痒みに対して有効な、天然物由来のかゆみどめ、アトピー性皮膚炎やアレルギー性症状の予防及び治療となる、抗アレルギー剤、皮膚外用剤、皮膚炎抑制剤及び浴用剤の提供。

【解決手段】 ベニカミキリフラスを成分として含有することを特徴とする抗アレルギー剤、皮膚外用薬、皮膚炎抑制剤及び浴用剤。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-008022
受付番号	50200049425
書類名	特許願
担当官	笹川 友子 9482
作成日	平成14年 5月 8日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年 1月16日
【特許出願人】	
【識別番号】	899000057
【住所又は居所】	東京都千代田区九段南四丁目8番24号
【氏名又は名称】	学校法人 日本大学
【代理人】	申請人
【識別番号】	100074505
【住所又は居所】	東京都渋谷区代々木1丁目58番10号 第一西 協ビル113号
【氏名又は名称】	池浦 敏明
【代理人】	
【識別番号】	100106530
【住所又は居所】	東京都渋谷区代々木1丁目58番10号 第一西 協ビル113号
【氏名又は名称】	古宮 一石

特2002-008022

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [899000057]

1. 変更年月日	1999年 9月17日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区九段南四丁目8番24号
氏 名	学校法人日本大学



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**